

電気・電子材料の評価・管理への 熱分析技術の応用

安福 幸雄^{*}, 谷井 剛^{*}

(昭和 62 年 7 月 23 日受理, 昭和 62 年 8 月 25 日再受理)

Application of Thermal Analysis Techniques to Appraisal and Quality Control of Electrical and Electronic Materials

Sachio Yasufuku and Takeshi Tanii

Status quo of the application of thermal analysis techniques to the appraisal and quality control of electrical and electronic materials is reviewed. Such thermal analysis techniques as TG, DTA, DSC, TMA, EGA, TSC are dealt with, whereas such electrical and electronic materials as enameled magnet wires, varnishes, epoxide resins, thermoplastic resins including cross-linked polyethylenes, thermosetting resins, mineral base transformer oils, ZnO varistor, rotating machinery insulation systems, printed circuit boards, solder glasses, photoresists, carbon fiber reinforced plastics, electronic ceramics, are investigated by use of the above-mentioned techniques. By taking advantage of these collected data, it is suggested that one can provide a data-base for electrical and electronic materials. Furthermore, it is reasonable to say that when one should develop a new material, one could adopt most suitable thermal analysis technique for its appraisal, referring to the collected data-base. The authors lay particular emphasis on applying extensively these thermal analysis techniques for developing new electronic materials.

1. はじめに

最近における熱分析技術の進歩は目覚しく、熱分析機器のハイテク化や低価格化と相まってもはや本技術は成熟し、その応用はルーチン化したと言えよう。広義の熱分析技術の基礎は既に確立し、その応用の対象は工業材料のみならず、バイオのような生体材料をも含むするよう拡大の一途をたどっている。当然のことながら電気材料や特に電子材料の評価や品質管理に対する熱分析技術の応用も多岐にわたるために、なかなか全体を把握しにくい状況になってきた。そこで筆者らは分散しているこれらの公表された文献やデータをできるだけ集めてレビューし、これらの材料に対する熱分析技術の応用の全

ぼうを明らかにするとともに、熱分析がこれからの新素材や新機能材料の開発と電気・電子材料としての応用のためのより有力な評価・管理手法でありうることを示唆した。

2. 热分析技術の適用対象とその範囲

この解説では無機と有機の電気材料並びに無機と有機の電子材料を対象として取り扱い、金属材料を除外する。すなわち、エナメル線、絶縁ワニス、エポキシ樹脂、架橋ポリエチレンを含む熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、鉱物系変圧器油、酸化亜鉛バリスタ、回転機絶縁システム、プリント回路基板、はんだガラス、フォトレジスト、ガラス繊維強化プラスチックス(CFRP)、電子用セラミックスなどが含まれる。また、熱分析技術の範囲は熱重量測定(TG)、発生気体分析(EGA)、示差熱分析(DTA)、示差走査熱量測定(DSC)、熱機械分析(TMA)と熱刺激電流測定(TSC)である。これらの基礎は既に多くの著書や論文に記述されているので^{1~6)}、ここでは省略し

* (株)東芝重電技術研究所:川崎市川崎区浮島町 2 番 1 号 〒210

Heavy Apparatus Engineering Laboratory,
Toshiba Corporation, 2-1, Ukihimacho, Kawasaki,
Kawasaki, Kawasaki 210 Japan

て、それぞれの手法によってえられる測定量から誘導される情報を列挙する。

- (1) TG : 热安定性の評価と耐熱寿命の推定。
- (2) DTA : 転移および融解温度と吸着水などの脱離現象の測定。
- (3) DSC : 比熱、融解熱、純度の測定と反応の速度論的解釈。
- (4) EGA : 热安定性の評価と耐熱寿命の推定。
- (5) TMA : 热機械的性質と熱膨脹率の測定。
- (6) TSC : 双極子分極などから見た転移と融解の観察。

この解説では上記以外の広義の熱分析に包含されるその他の手法を取り扱わない。

3. 有機電気材料と TG

電気絶縁材料の熱安定性の評価法は既に IEEE (アメリカ電気電子学会), IEC (国際電気標準会議) や ASTM (アメリカ材料試験協会) によって確立されているが、これらはすべて長時間をする促進劣化試験の形をとっているので、いわゆる短時間熱安定性試験法の開発が試みられ、電気学会絶縁材料耐熱性試験法調査専門委員会は特に長年月この問題に取り組み、多くの報告書を取りまとめてきた^{7~9)}。その主体は TG についてであって、既に本誌上でその概要が報告されている¹⁰⁾。そこでは TG は有力な手法であるが、データの再現性等に問題が残っており、最も重要な活性化エネルギー ΔE は複数の TG 曲線から求めることが指摘されている。また TG のメカによる機差の影響も報告された¹¹⁾。

一般に、熱分解の速度論的解析には小沢の手法が最も妥当な方法として適用され、その分解速度が n 次反応か、高分子主鎖の無秩序解裂反応か、または拡散律速反応かを知ることができる¹²⁾。また比較的妥当な ΔE 値を求めるこどもできる。その換算時間 θ を劣化度と呼び、エポキシ樹脂の劣化度と微分熱重量曲線 (DTG 曲線) の第 1 ピークにおける分解速度との相関が認められた¹³⁾。塩素処理されたポリプロピレンの TG 曲線の第 2 反応について高分子主鎖の無秩序解裂の式を適用した結果、比較的よい適合性が見られた例を Fig. 1 に示す¹⁴⁾。次にマレイミド変性エポキシ樹脂の TG 曲線を解析した結果 n 次反応に適合し、マレイミド網目の Interpenetrating Network (IPN) 効果の形成によって熱安定性が向上することがわかった¹⁴⁾。エポキシ樹脂/ジカルボン酸/DMBA 系の DTG 曲線を Fig. 2 に示す¹⁵⁾。小沢の手法によって計算した ΔE はいずれの場合も約 40 kcal/mol となり、分解反応が同一機構で進んでいることが推定できた。なお各種ポリマーの熱分解反応の速度論的解析の例として、

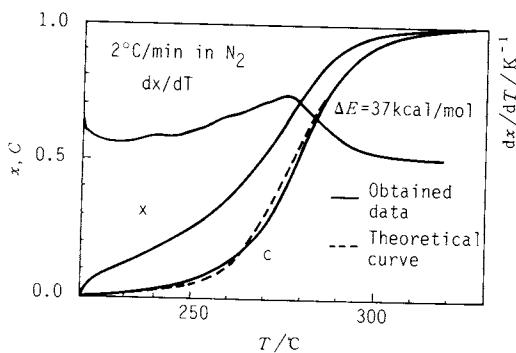


Fig. 1. TG curve vs. theoretical curve based upon random scission for chlorinated polypropylene. The symbols, C , x and T are the conversion, the fractional bond broken and the temperature.

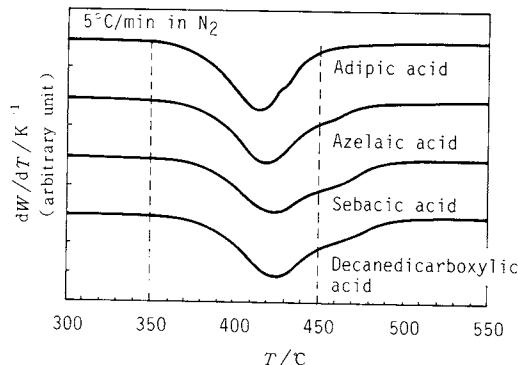


Fig. 2. DTG curves for epoxy resin/dicarboxylic acid/DMBA system.

計算機に取り込んだ測定データと理論を用いて理論微分曲線を求め、さらに理論熱重量曲線を求めて測定データの比較を行なうという反応速度論的解析法 (逆算法といふ) についての報告もある¹⁶⁾。

TG 法は前記のように短所があり、促進劣化試験から得られた耐熱温度指数 (Temperature Index, TI) などとの相関も必ずしもよいとはいえない場合もあるので、最近では EGA による熱安定性の評価に注力されているのが現状である。

4. 有機電気材料と DSC

DSC の応用は多岐にわたっていて、特に高電圧用絶縁体として使用されるオレフィン系ポリマーの結晶の融解現象を追跡してその物性の微小変化を求めたり、このようなポリマー中の微量な水分の存在状態を推定してその絶縁体に及ぼす影響を考察したりしている。すなわち、架橋ポリエチレン絶縁電線ではその製造中および使用中

に受ける加熱効果を定量的に求めることが必要であって、その融点と架橋度の尺度になるキシレン抽出量との直線関係を Fig. 3 に¹⁷⁾、その融点以下の温度での再結晶化に基づく第二ピークの発生を利用した熱履歴の推定の一例を Fig. 4 に¹⁸⁾それぞれ示す。

また、過酸化物 DCP による架橋反応を追跡した例¹⁹⁾や架橋ポリエチレン絶縁電線特有の電気的な劣化現象の

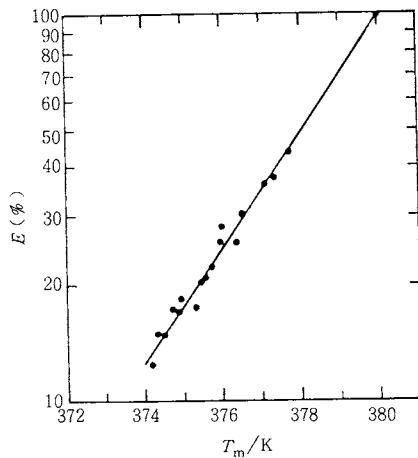


Fig. 3. DSC melting temperature (T_m) of cross-linked polyethylene as a function of percent extractables (E) (The melting temperature was taken as the maximum peak temperature.)

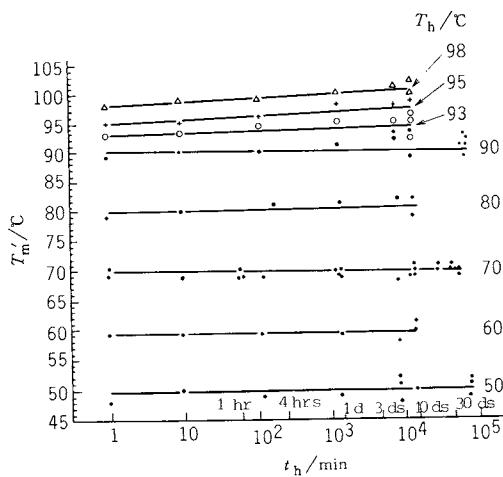
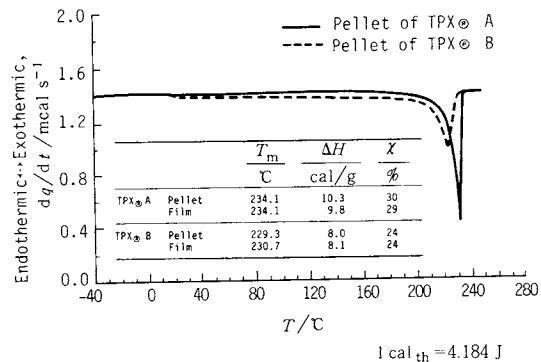


Fig. 4. Estimation of thermal history imposed on crosslinked polyethylene by a new method of subtracting original DSC curve from its annealed DSC curve. T'_m is the peak temperature obtained by the subtraction, and t_h and T_h are the time and temperature of annealing.

一つである水トリー（水と電界の共存下で、導体表面や絶縁体中から電界方向に樹枝状の微小浸食が生じた劣化痕跡をいう）の発生したそのフィルム中の水分の状態分析の例もある²⁰⁾。さらに、その加速劣化試験における結晶度等の変化のモニターにも、酸化防止剤の活性度の測定や酸化安定性の評価にも適用された²¹⁾。

ポリ 4-メチルペンテン-1 (TPX®) について始めてえられた結晶度などを Fig. 5 に示す²²⁾。高圧コンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルムの主ピーク Mp (α 形結晶融点で成膜過程の相違を反映) と副ピーク (配向効果を示して熱処理効果を反映) を Fig. 6 に示す²³⁾。ポリエチレン中の Clustered water の検出を Fig. 7 に示す²⁴⁾。



$$1 \text{ cal}_\text{th} = 4.184 \text{ J}$$

Fig. 5. DSC heating curves for TPX® and crystalline m.p./heat of fusion/crystallinity for TPX® products. The symbols, q , t , ΔH and χ are the heat, the time, the heat of fusion and crystallinity, respectively.

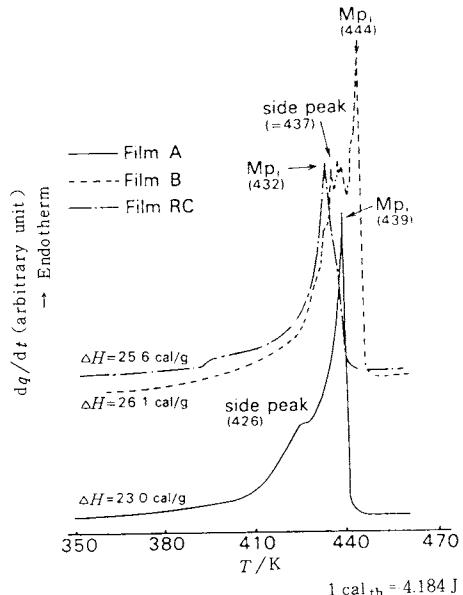


Fig. 6. DSC fusion curves for polypropylene films.

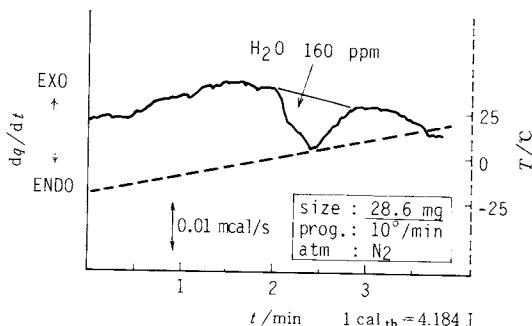


Fig. 7. Estimation of clustered water content in polyethylene by DSC method.

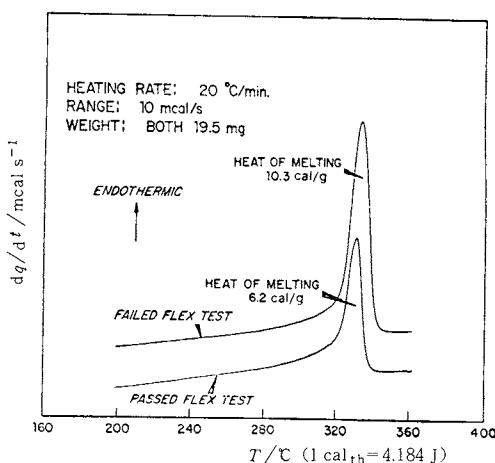


Fig. 8. Characterization of PTFE wire insulation by DSC method.

テフロン絶縁体における大きな融解熱(高い結晶化度)と高い拡張力/低い屈折強度の関係を Fig. 8 に示す¹⁹⁾。電気用フェノール樹脂の架橋発熱を密封セル中で測定して、触媒効果の検討と最適温度一時間関係の決定を可能にした¹⁹⁾。エポキシ樹脂の硬化反応機構や架橋反応力学の検討の例もある²⁰⁾。

最後に電気絶縁油への適用の例として、バラフィンワックスの定量^{26~28)}や融解現象の追跡²⁹⁾と油中水分の存在状態の推定がある³⁰⁾。

5. 有機電気材料と EGA

EGA は通常分解ガス中の主成分である炭酸ガスをガスクロマトグラフや赤外線炭酸ガス分析計によって定量することによって実施される³¹⁾。一般にこの方法によればデータのバラツキが小さく、直線性がよく成立し³¹⁾、えられた ΔE は従来の方法でえられた値とかなりよく一致することがわかった³²⁾。EGA から求められる寿命の温度依存性が、熱劣化の見かけの ΔE を材料が実使用さ

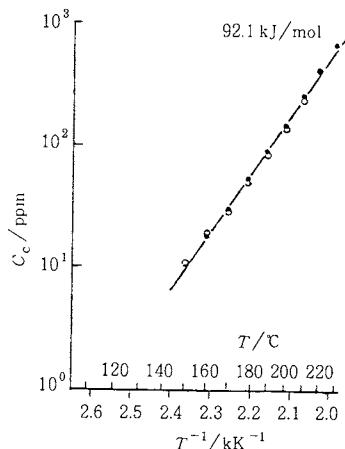


Fig. 9. Temperature dependence of concentration of carbon dioxide evolved from alkyd varnished glass cloth. The ordinate, C_c is the concentration of CO and CO_2 in evolved gas.

れる温度域からかなりの高温度域まで良好に反映しうるとの考えに基づいている。赤外線炭酸ガス分析計によるアルキド樹脂ワニスガラスクロスのデータの一例を Fig. 9 に示す³¹⁾。

かくして EGA による ΔE の算出や熱安定性の評価は現状での最も有望な短時間試験の手法として電気学会絶縁材料耐熱性短時間試験方法調査専門委員会で検討され、IECにおいても取り上げられて日本の貢献は著しい。

6. 有機電気材料と TMA

TMA は単独でなく TG などと併用される。エポキシ樹脂モールドブッシングのモールド条件を決めるために、試作した現物よりいくつかの試料を採取した後、熱膨脹率を求めて、別にえられたガラス転移温度値も利用して最適モールドサイクル条件が確立された³³⁾。ポリエチレン熱収縮チューブに適用された例もある¹⁹⁾。すなわち、そのキャラクタライゼーションのために TMA を測定し、方向によって微小な相違があること、熱収縮のパターンが明確にえられることを Fig. 10 に示す。このように熱機械的性質や熱膨脹率の測定によって品質管理やキャラクタライゼーションを行うことができる。

7. 有機電気材料と TSC

すでに高分子の TMA、TSC を中心とした熱分析が本誌上で報告されている³⁴⁾。その中で高分子の機能を高める試みの中で TSC を用いて研究されているものに、添加剤の混入、ランダム共重合体化、ブロック共重合体

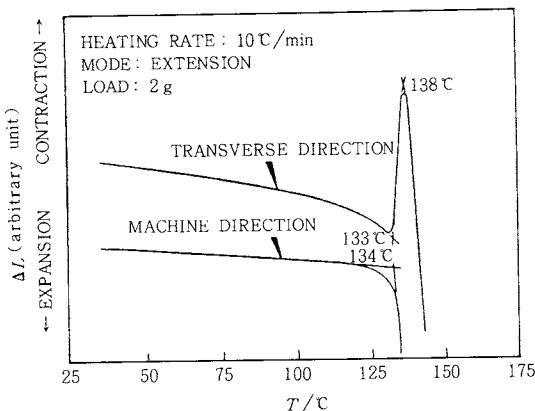


Fig. 10. Characterization of polyethylene heat shrink wire insulation by TMA. The ordinate, ΔL , is the thermal contraction.

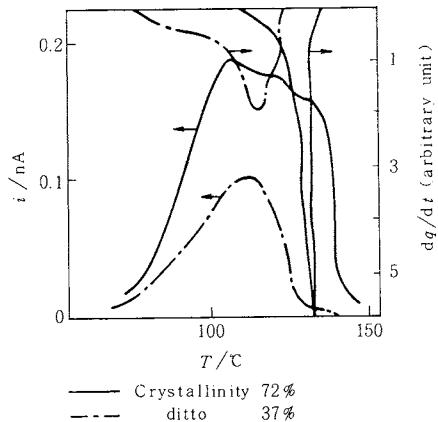


Fig. 11. Relationship between TSC peak temperature and DSC peak temperature for electron-irradiated polyethylene film. The left ordinate, i , is the thermally stimulated current.

化、高分子のブレンド、ガラス纖維との複合化などがある⁸⁴⁾。

電子線照射したポリエチレンフィルム（結晶化度の異なる樹脂を使用）のTSCのピークがDSCのピークとよい一致を示すことをFig. 11に示す⁵⁾。結晶が融解するとともにTSCも増加していることがわかる。高電圧機器絶縁では複合材料を使用するために、界面分極を形成するので、TSCのピークの出現によってそれを知ることができる⁵⁾。シリコーン油浸片面アルミニウム蒸着ポリプロピレンフィルム系、NaCl等の不純物を含有する鉱物／クラフト紙系においてそのようなピークを見出すことができる⁵⁾。電気絶縁油－高分子系のTSCに関する研究はその緒についたばかりであり、今後の展開が望

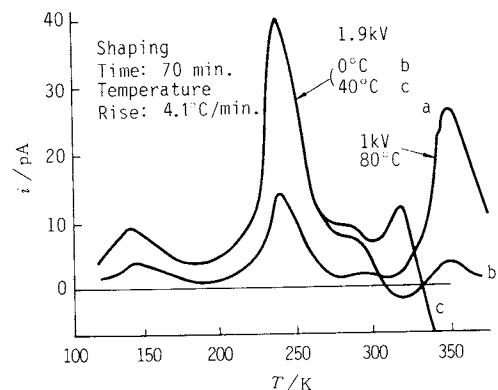


Fig. 12. TSC curves for oxidized high-density polyethylene.

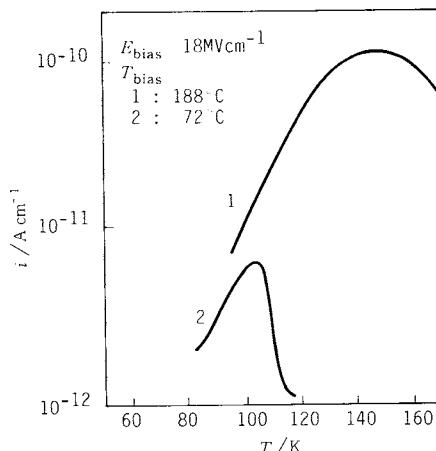


Fig. 13. TSC curves for mica/epoxy resin composite insulation system.

まれる。

高分子絶縁材料の劣化の過程は、主鎖、側鎖および各種の置換基や末端基が関与する緩和過程の変化を伴い、双極子配向に起因するTSCに影響を及ぼす。高密度ポリエチレンをオゾン浴中で酸化させた試料についてのTSCをFig. 12に示す⁵⁾。300K以下の温度領域に出現する四つのピークはいずれも注入電荷のカルボニル基などのトラップからの解放によると推定される⁵⁾。その他ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、ポリエーテルスルホンなどについての報告もある⁵⁾。

高電圧回転機複合絶縁には主にマイカ・エボキシ絶縁が用いられており、界面分極を示す。そのTSCをFig. 13に示す⁵⁾。TSCピーク(1)が、ポリマーマトリックスのガラス転移に関連する双極子配向分極によるピーク(2)の高温側に観測され、この特長的なピークは試料中のキャリアが、ポリマーマトリックスとマイカフレーク

の界面に蓄積した界面分極から生じると考えられる。なお、ポリエチレンを代表例として TSC についての研究成果がまとめられている⁵⁾。また、各種の高分子の TSC 測定の論文名も集められている⁵⁾。

8. 無機電気材料と DTA

セラミックスへの熱分析の応用についてはすでに本誌上で報告されている³⁵⁾ように、粉末X線回折と一緒に用いることによって実りのある状態分析が可能になる。特に融解・転移・分解などの状態変化温度を知ることができる DTA は有力な手段であって、膨大なチャートが集積されている³⁵⁾。しかし、無機電気材料への応用の例は

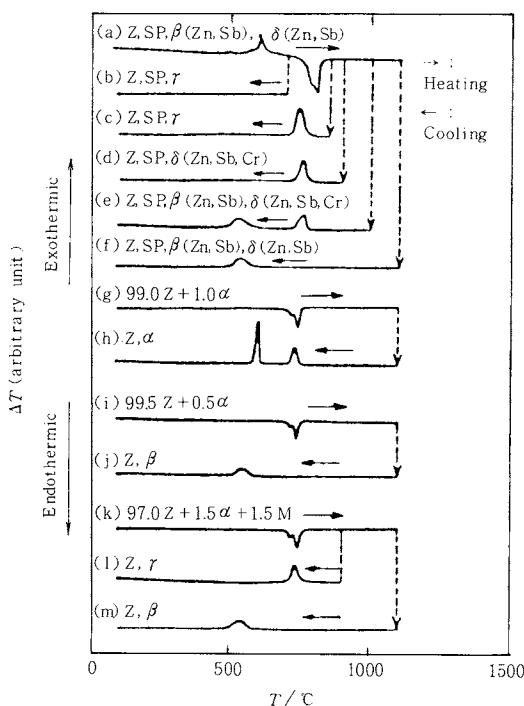


Fig. 14. DTA curves of non-ohmic ZnO ceramics with five additives sintered at 1350°C, and pressed discs of mixtures in the systems ZnO - Bi₂O₃ and ZnO - Bi₂O₃ - MnO₂
 (a)-(f): Non-ohmic ZnO ceramics with five additives
 (g)-(m): Pressed discs of mixtures in the systems ZnO - Bi₂O₃ and ZnO - Bi₂O₃ - MnO₂ (mol.%)
 Z: ZnO; SP: Zn₇Sb₂O₁₂ spinel; β (Zn,Sb): β -Bi₂O₃ containing Zn and Sb;
 δ (Zn,Sb): δ -Bi₂O₃ containing Zn and Sb; δ (Zn,Sb,Cr): δ -Bi₂O₃ containing Zn, Sb and Cr; γ : γ -Bi₂O₃; α : α -Bi₂O₃, M: MnO₂. The ordinate, ΔT , is the temperature difference.

少なく、バリスター（非直線抵抗体）の一つである ZnO セラミックスへの熱処理効果を DTA で求めた貴重な実例を Fig. 14 に示す³⁶⁾。ZnO に添加された Bi₂O₃ の加熱と冷却による相変化などを現わしている。特異的な吸熱および発熱ピークが認められる。これらの相変化や微細構造の変化がバリスターの非直線定数 α と関係づけられて考察された³⁶⁾。

9. 有機電子材料と TG

有機電気材料の場合とは異なり、長期間の熱安定性をうんぬんすることは少なく、また分析的手段として用いられる。半導体封止樹脂等用のポリイミドにおける閉環反応性が TG で検討された例を Fig. 15 に示す³⁷⁾。実線はイミド化反応における第一段階反応を、破線は第2段階反応をそれぞれ示し、脱水による重量減少量は最終的に理論脱水量に近くなる。このような方法によって各種のポリアミド酸の反応性を検討した。

次に、TG による熱分解データからアルレニウスプロットによる活性化エネルギーを求めてジアミンの構造の相違による耐熱性の優劣が比較された。エポキシプリント配線基板（以下 PCB と略す）のガラス纖維含有量をモニターするのに TG が常用されている¹⁹⁾。ここでは空気中でエポキシ樹脂が完全に分解され、ガラス纖維のみが残る。

次にエポキシ PCB における湿気の存在は望ましくないので、その量は TG によって鋭敏に検出される¹⁹⁾。窒素ガス中で加熱すると、 T_g 近傍で水分の損失が発生して 100°C 近くで減量は一定になり、水分が 1.2% となった。またポリエステル PCB の重量分析にも応用された。すなわち炭酸カルシウムを含有したポリエステル PCB の TG の例を Fig. 16 に示す¹⁹⁾。ここでは 500°C までにポリエステルが分解した後、CaCO₃ が分解し CO₂ を発生する。この重量減から CaCO₃ の配合量を本図のように算出することができ、残りはガラス纖維量となる。類似の方法で PCB 用難燃性ポリエステル（水和アルミナが混入）のポリエステルと水和アルミナ含有量を分析することができる¹⁹⁾。これは加熱残が Al₂O₃ であるために、Al(OH)₃ を逆算することができ、最終的にポリエステル含有量が算出される。

なおエレクトロニクス用にシリングガラスが使用されるが、これはガラスの輸送を良くするために有機のベヒクルが添加されている。これは完全に揮発しなければならない¹⁹⁾。このプロセスを特長づけるために、TG が応用されその含有量と 250°C までに起きた完全な分解（ガラスの転移温度は 340°C である）が確認された。

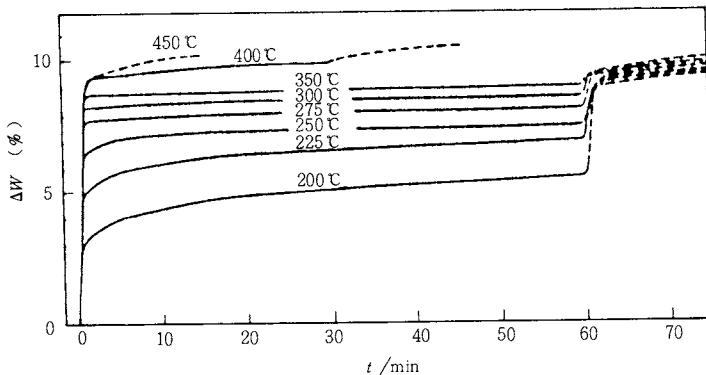


Fig. 15. Weight loss (ΔW) of an aromatic polyamic acid during its imidization reaction.

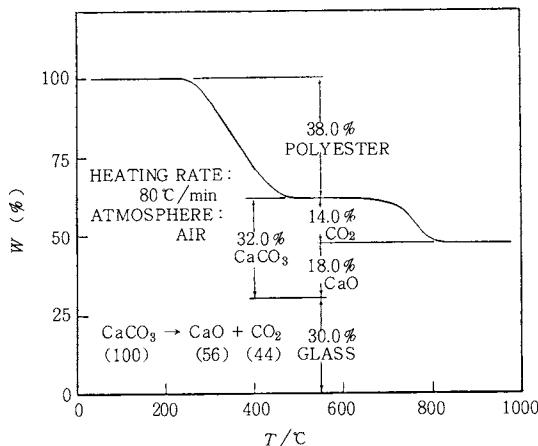


Fig. 16. Analysis of carbonate filled polyester PCB by TG. The ordinate is the weight.

10. 有機電子材料とDSC

近來有機電子材料の評価や管理への DSC の応用は目覚ましく、ここでその全体を網らることは不可能であり、文献等で目立ったものに限定する。IC デバイスのフォトレジストの UV 照射や加熱した試料の DSC 測定によって T_g の変化や感光剤の分解等が検討され³⁸⁾、このような光重合反応を直接モニタすることができる DSC 装置も開発された³⁹⁾。電子線感応型レジスト薄膜の DSC 測定から基板との間に生じた残留応力の緩和が見出され⁴⁰⁾、またそのようなレジストの加熱後の冷却速度依存性が Fig. 17 のように示されてエンタルピー緩和と溶解性の関係が評価された⁴¹⁾。

PCB 用エポキシプリプレグの架橋とか加速劣化による品質の変化のチェックにも適用され、後者の場合 T_g の上昇等が Fig. 18 に明りょうに認められる³⁸⁾。PCB の

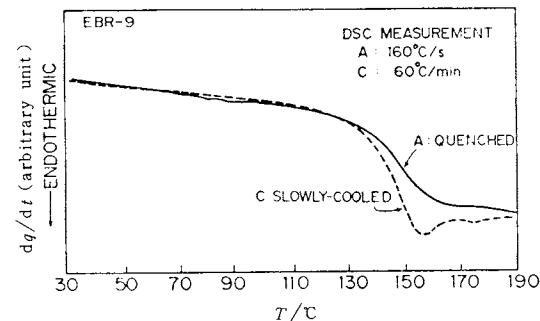


Fig. 17. DSC curves for a highly sensitized electron-beam resist obtained at heating rate of 10°C/min.
A: specimen quenched to 20°C from 180°C; C: specimen cooled slowly

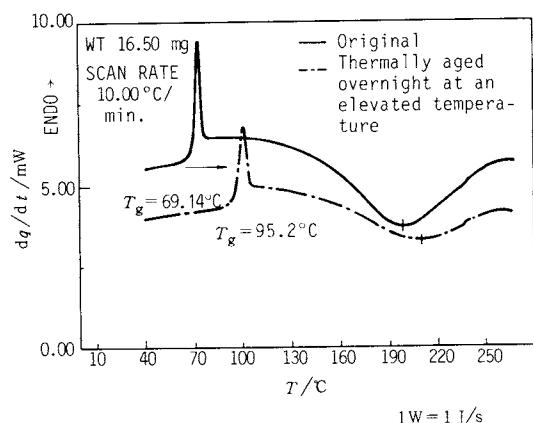


Fig. 18. DSC curves for epoxy prepreg available for PCB, subjected to accelerated thermal aging.

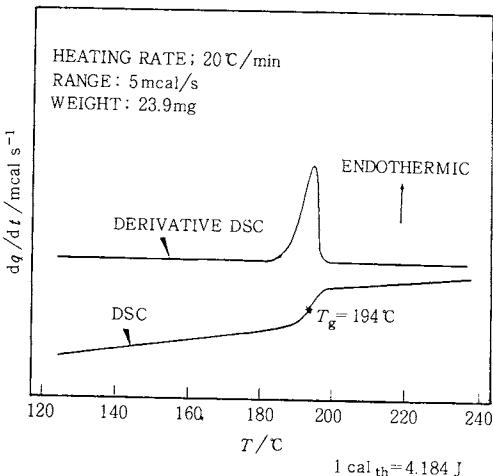


Fig. 19. Determination of glass transition of poly-sulfone PCB using derivative DSC.

T_g は DSC のグラフ上で不明りょうな場合があるので、その第一次導函数のグラフを同時に作成するとよい。一例をポリスルホン PCB の例で Fig. 19 に示す¹⁹⁾。他にエポキシ PCB やフレキシブル PCB の例もある¹⁹⁾。

液晶ではその転移温度範囲が実用上も重要であって、DSC が常用されており、多数の例がある^{41), 42)}。

はんだガラスのキャラクタリゼーションにも用いられた¹⁹⁾。

航空宇宙材などに用いられている炭素繊維強化プラスチックのモールド時、型の相違がその成型品の T_g に影響することが見出され⁴³⁾、また一般に DSC がその製造条件の維持と品質管理に用いられている⁴⁴⁾。OA 機器やコンピュータなどに用いられる発泡プラスチックのうち、低密度ポリエチレン発泡体における発泡プロセスが DSC でフォローされたり¹⁹⁾、電子部品用に使用される帯電防止プラスチック(ナイロン 6)の中の帯電防止剤の定量も行なわれた¹⁹⁾。

11. 有機電子材料と TMA

TMA は PCB などの熱膨脹率を測定するのによく用いられ、エポキシ PCB を加熱／冷却後再加熱による TMA で正確にその熱膨脹率が求められた³⁸⁾。

また PCB の離層温度や離層時間を求める手法も開発されて PCB の評価や管理に用いられた⁴⁵⁾。ポリエステルやエポキシ系封止樹脂を IC 部品に適用する場合に、その熱膨脹率の大きさがその部品と整合することが要求される。したがって TMA の測定は極めて重要であり、ポリエステル樹脂の例がある¹⁹⁾。その他のモードの TMA の応用についてはここでは省略する。

12. 有機電子材料と TSC

発光ダイオード(LED)封止用のポリアミド樹脂硬化エポキシ樹脂の温湿度処理(70°C, 91% RH, 1,000時間)前後における TSC の測定結果を Fig. 20 に示す⁵⁾。いずれのピークも双極子緩和に起因し、この劣化とともにピーク 1 (P_1) は減少するのに、ピーク 2 (P_2) は増大する。そして赤外吸収スペクトルより求めた水酸基やカルボニル基の吸収の変化と関係づけられた。また電子デバイスの封止樹脂としてエポキシ樹脂が用いられるが、それに含まれる微量のイオン性不純物が問題となっている。そこで硬化剤の異なるエポキシ樹脂の TSC から求めた放電電荷量とこれらを用いたトランジスタの高温逆バイアス試験後の漏れ電流増加率との間に定性的に良い相関関

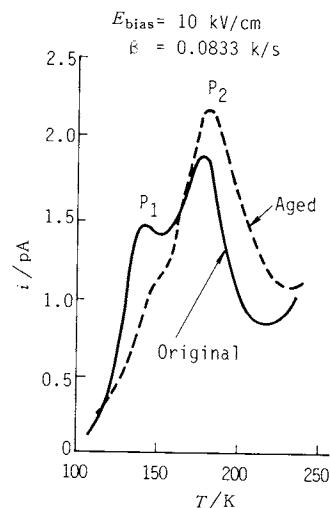


Fig. 20. TSC curves of polyamide cured epoxy resin, subjected to heat/humidity treatment.

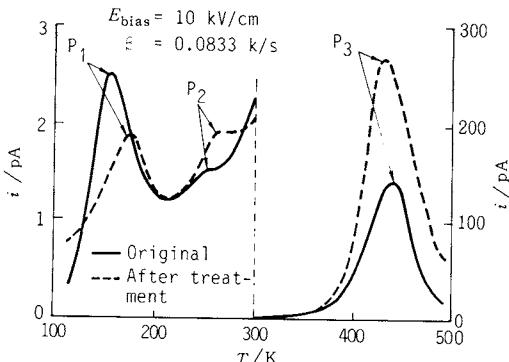


Fig. 21. TSC curves of polyimide resin, subjected to heat/humidity treatment.

係が求められた⁵⁾。

最後にエレクトロニクスに対するポリイミド樹脂の応用は増大しており、上記のエポキシ樹脂と同様の処理前後のTSCが測定されその結果をFig.21に示す⁵⁾。いずれのピークも双極子緩和に起因し、処理の前後でそれぞれ変化している。

13. 無機電子材料とDTA

エレクトロニクセラミックスに対する応用の例を挙げると、ICチップのハンド成分の決定⁴⁶⁾や液相焼結助剤の探索(例えば、ZnS系、Pb(Fe_{1/2}Nb_{1/2})O₃-Pb(Fe_{2/3}W_{1/3})O₈系など)などがある³⁵⁾。オプトエレクトロニクス材料として有望なLiNbO₃のキュリー温度がDTAを利用して求められた⁴⁶⁾。薄膜のキャラクタリゼーションも重要性が急増していて、Fig.22にアモルファスSe薄膜のDTAを示す⁴⁶⁾。40°CのピークはT_g、100~150°Cの大きなピークは結晶化、220°C付近の吸熱ピークは融解にそれぞれ相当する。なおDTAによって粉体の活性と内部エネルギーの増大や固液系の反応過程も検討されている⁴⁶⁾。

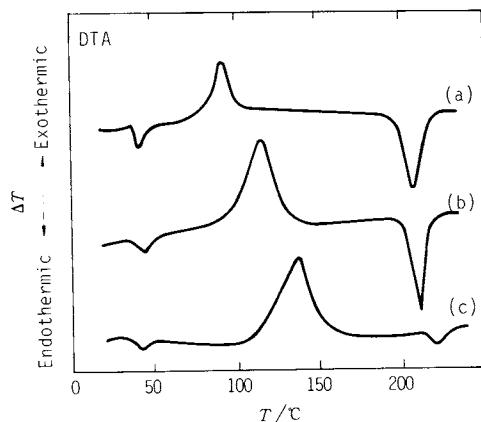


Fig. 22. DTA curves of amorphous Se thin films.
(a) substrate alone (b) thin film stripped off from substrate (a) (c) specimen powdered amorphous Se quenched its molten state

14. おわりに

本解説では既に熱分析関係の成書^{1~4)}に記載されている例を除外して、国内外の関係の技術論文から電気および電子材料に関する熱分析の実際例を蒐集した。電気および電子材料はそれに対する要求が他の分野の材料と若干異なるために、熱分析の応用の仕方に特異性が見出されることがあるが、本質的には熱分析の手法や技

術的解析は同じであると考えてよい。しかし、いろいろな熱分析の手法を巧妙に駆使することによって、少量の試料で迅速に極めて重要な評価や工程管理および品質管理が可能であり、熱分析機器の価格の低下や自動化と相まってその使用はますますルーチン化すると思われる。この解説がそのような技術的進歩の展開に少しでも参考になれば幸いである。最後に筆者らの執筆に対して便宜を与えられた(株)東レリサーチセンター・十時稔氏および(株)パーキンエルマー・ジャパンにお礼を申し上げる。

なお、本文中の1 calは4.184 Jである。

引用文献

- 日本熱測定学会編、熱分析の基礎と応用(株)科学技術社(1985)
- 経営開発センター出版部、各種熱分析技術の基礎応用と測定データ集、工業情報センター出版部(1985)
- 神戸博太郎編、熱分析、講談社(1975)
- 十時 稔、高分子データハンドブック(高分子学会編)、培風館(1986)、684
- 絶縁材料の熱刺激電流と空間電荷調査専門委員会、電気学会技術報告(Ⅰ部)、No.194(1985)
- 小沢丈夫、ぶんせき、186(1987)
- 絶縁材料耐熱性試験法常置専門委員会、電気学会技術報告(Ⅰ部)、No.121(1977)
- 絶縁材料耐熱性試験法調査専門委員会、電気学会技術報告(Ⅱ部)、No.134(1982)
- ト部恭一、金子 剛、電気学会絶縁材料研究会資料、EIM-81-22(1981)
- 須納瀬 司、金子 剛、熱測定 10, 66(1983)
- 佐藤健一、谷井 剛、三井久安、吉田 宏、電気学会絶縁材料研究会資料、EIM-85-24(1985)
- T. Ozawa, Bull. Chem. Soc. Jpn. 38, 1881(1965)
- 坪根嘉房、宮崎治雄、押山 孜、電気学会絶縁材料研究会資料、EIM-85-23(1985)
- 長田慶子、宮本文行、渡辺忠勝、渋谷義一、第21回熱測定討論会講演要旨集I 102A(1985)
- 長田慶子、宮本文行、渡辺忠勝、渋谷義一、第22回熱測定討論会講演要旨集E 203(1986)
- 長田慶子、渡辺忠勝、宮本文行、中島博行、電気学会絶縁材料研究会資料、EIM-85-25(1985)
- M. Duval, H. St-Onge, IEEE Trans. Electr. Insul. EI-14, 264(1979)
- 関口 武、並木幸彦、昭和電線電纜レビュー、35, 89(1985)
- W. P. Brennan, R. B. Cassel, Perkin-Elmer Thermal Analysis Application Study, 1978, No. 25
- R. A. Weiss, S. H. Shaw, M. T. Shaw, Proc. 16th Electrical/Electronics Insulation Con-

- ference, CH1952-1/83/0000-0003 (1983)
- 21) J. A. Hassell, G. R. Hattery, M. M. Epstein, Proc. 17th Electrical/Electronics Insulation Conference, 2 (1985)
- 22) 安福幸雄, 石岡康昭, 高分子論文集 **42**, 121 (1985)
- 23) T. Umemura, K. Akiyama, D. Couderc, *IEEE Trans. Electr. Insul.* **EI-21**, 137 (1986)
- 24) H. E. Bair, G. E. Johnson, *Analytical Calorimetry*, Vol. 4, 219 (1977)
- 25) 宮本文行, 長田慶子, 岡 誠次, 中島博行, 第22回熱測定討論会講演要旨集 E 202 (1986)
- 26) T. O. Rouse, Conference Record 1978 IEEE International Symposium Electrical Insulation, CH/1287-2/78/0000-0250 (1978)
- 27) S. Yasufuku, *Sekiyu Gakkaishi* **27**, 525 (1984)
- 28) 安福幸雄, 热測定 **12**, 161 (1985)
- 29) S. Yasufuku, *Sekiyu Gakkaishi* **28**, 485 (1985)
- 30) S. Yasufuku, *IEEE Trans. Electr. Insul.* **EI-17**, 466 (1982)
- 31) 金子 剛, 小沢丈夫, 電気学会論文誌 **97-A**, 33 (1977)
- 32) 電気学会絶縁材料耐熱性短時間試験方法調査専門委員会資料, 7-1 (1987)
- 33) R. K. Khattak, E. E. Woods, Proc. 14th Electrical/Electronics Insulation Conference, 79CH1510-7/79/0000-0123 (1979)
- 34) 加藤貞二, 热測定 **11**, 7 (1984)
- 35) 逸見 博, 水谷惟恭, 加藤誠軌, 热測定 **13**, 81 (1986)
- 36) M. Inada, *Jpn. J. Appl. Phys.* **18**, 1439 (1979)
- 37) 沼田俊一, 藤崎康二, 金城徳幸, 向井淳二, 電気学会絶縁材料研究会資料, EIM-81-78 (1981)
- 38) M. P. DiVito, W. P. Brennan, C. J. Williams, B. Cassel, Perkin-Elmer Applications of Thermal Analysis in the Electronics & Semiconductor Industries, **1986**, No. 1122
- 39) J. E. Moore, S. H. Schroeter, A. R. Shultz, L. D. Stang, "Ultraviolet Light Induced Reactions in Polymers" (S. S. Labana ed.) Amer. Chem. Soc. (1976), p. 93
- 40) 野牧辰夫, 重光文明, 第22回熱測定討論会講演要旨集 D 314 (1986)
- 41) P. C. Jain, S. R. S. Kafle, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* **129**, 199 (1985)
- 42) 国久和子, 文献 2), p. 253
- 43) 大橋秀樹, 老沼 巍, 東芝レビュー **41**, 108 (1986)
- 44) 十時 稔, 高分子・複合材料への応用, 第15回熱測定講習会資料 (1987)
- 45) Y. E. Araktingi, J. Feinberg, M. Plunkett, G. Roth, Proc. 16th Electrical/Electronics Insulation Conference, CH1952-1/83/0000-0003 (1983)
- 46) 桜井 修, 木枝鴨夫, 水谷惟恭, セラミックス **20**, 1030 (1985)

入会

案内

日本熱測定学会では、(i)会誌「熱測定」の発行(年4回), (ii)熱測定討論会の開催(年1回), (iii)「熱測定の進歩」の発行(年1回), (iv)熱測定講習会の開催(年1~2回), (v)熱測定ワークショップの開催(年1~2回), (vi)各国の熱測定学会および国際学術組織(IUPAC, IICTA, CODATA等)との交流を事業として行ってお

りますほか、BCT情報収集作業グループ、熱測定応用研究グループ、熱力学データベース作業グループなどの各研究グループを設けて、会員の便宜をはかっておりま

す。入会を希望される方は、事務局に入会申込書がありますので御利用下さい。

会費(会計年度は10月1日より翌年9月30日)

正会員(個人) 年額 3,000円

維持会員(法人) " 20,000円(1社)以上

日本熱測定学会事務局〒113 東京都文京区本郷3-32-5 本郷ハイツ501号

電話 03-815-8514 振替東京9-110303